PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-163374

(43) Date of publication of application: 22.06.1990

(51)Int.Cl.

C23C 14/54

(21)Application number: 63-318498

(71)Applicant: OKI ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

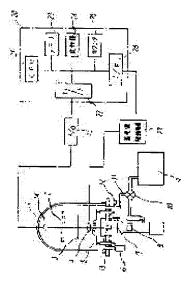
19.12.1988

(72)Inventor: KOIKE HIROSHI

(54) JUDGING METHOD FOR FILM THICKNESS VALUE IN VACUUM DEPOSITION (57)Abstract:

PURPOSE: To accurately judge the maximum point and the minimum point of the read-in value locus of measured value by periodically measuring the thickness value of a vacuum- deposited film with a photoelectric photometer and judging the increase or decrease thereof and deciding a pole from the counter value of the times of increase or decrease.

CONSTITUTION: Material is evaporated from an evaporation source 4 provided with a heater supporting base 5 in a bell jar 1 equipped with a vacuum system such as a rotary pump 9 and a thin film is vapor-deposited on a base plate 2. In the above-mentioned vacuum deposition, film thickness of the thin film on the base plate 2 is measured by projecting laser beams emitted from a laser beam radiating cylinder 13 and receiving beams with a photoelectric measuring instrument 14. This film thickness value is periodically measured and inputted



into a computer 20 via an A/D convertor 15. Therein this measured value is once stored in a memory 23 and thereafter compared with a comparator 24. It is judged that this measured value is increased or decreased in comparison with the preceding measured value. The times of increase or decrease are counted with a counter 25 and this counter value is regulated so that this value is not made negative. When the counter value reaches the prescribed value, the pole of maximum or minimum is judged by decrease or increase tendency and an driver 27 of the evaporation source is controlled by a CPU 21.

⑲ 日本 国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-163374

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成 2年(1990) 6月22日

C 23 C 14/54

8520-4K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

69発明の名称 真空蒸着における膜厚値の判定方法

> 顧 昭63-318498 21)特

22出 顧 昭63(1988)12月19日

池 寬 ⑫発 明 者

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

沖電気工業株式会社 勿出 顯

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

弁理士 清 水 守 外1名 四代 理 人

1. 発明の名称

真空蒸着における膜厚値の判定方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1)
- (a) 光電測光器の光度測定値による真空蒸若にお ける農厚値を周期的に測定する工程と、
- (b) 核測定値がその前に測定した値より地減した か否かを判別する工程と、
- (c) 該増減回数がカウンタにより計数され、その カウンタ値が負にならないようにすると共に所定 の値に速した場合には極点と判定する工程とを有 する真空蒸着における膜厚値の判定方法。
- (2) 前記測定値がその前に測定した値より減少 する傾向にある場合、極大点と判定する肺求項1 記載の真空蒸着における膜厚値の判定方法。
- (3) 前記測定値かその前に測定した値より増加 する傾向にある場合、極小点と判定する腺求項1 記載の真空蒸着における膜厚値の判定方法。

3. 発明の詳細な説明:

(産業上の利用分野)

本発明は、真空蒸着制御装置における光電測光 器の光度測定値の処理方法に関するものである。 (従来の技術)

従来、このような分野の技術としては、例えば 以下に示すようなものがあった。

直空舊者における慈着腰の光電測光器による光 皮測定軌跡は第7図に示すようになる。

世来の慈若制御方法においては、第7図の極大 点Na, Ma: …、極小点Ni, Ni: …の測定方法 として光度値をコンピュータを用い周期的に測定 し、極大点、つまり、光度拠定値が前の値より小 さくなった場合と、極小点、つまり、光度測定値 が前の値より大きくなった場合を測定し、蒸着膜 の形成状況を測定するようにしていた。ここでは、 多層蒸着ZnS , MgFx膜で放長 X = 550nm である。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、光電測光器の信号をA/Dコン バータを通して、コンピュータで読み込む場合、

信号値にノイズ成分があると、前述の極大点、極 小点の判定を誤ってしまう。

本発明は、以上述べたノイズによる極大点、極小点の誤判定という問題点を除去し、光電測定器 の読込値軌跡の極大点、極小点を正確に判定することができる真空蒸着における膜厚値の判定方法 を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明は、上記問題点を解決するために、真空 悪着における膜厚値の判定方法において、光電測 光器の光度測定値による真空蒸者における膜厚値 を周期的に測定する工程と、該測定値がその前に 測定した値より地減したか否かを判別する工程と、 該地減回数がカウンクにより計数され、そのカウ ンタ値が負にならないようにすると共に、所定の 値に達した場合には極点と判定する工程とを施す ようにしたものである。

ここで、前記測定値がその前に測定した値より 被少する傾向にある場合、極大点と判定し、前記 測定値がその前に測定した値より増加する傾向に

板、3はシャッタ、4は蒸発源、つまり各種の試料が回転体上に配置された複数の蒸発源(例えば 2ns , MeFaなどの蒸着源)、5はヒータ支持台、6は電離真空計、7は真空パルブ、8は液体窒素トラップ、9はロータリポンプ、10は2方向パルプ、11はあら引き用配管、12はピラニゲージ、13はレーザピームの放射筒、14はそのレーザピームにより蒸着胶を透過した光を受ける光電流光器、15はA/D変換器、20はコンピュータ、21はCPU(中央処理装置)、22は入力インタフェース、23はメモリ、24は比較器、25はカウンタ、26は出力インタフェース、27は蒸発源駆動装置である。

この図に示すように、真空蒸着装置は基本的には、排気系と、蒸発源4、基板2、シャッタ3等の真空室から構成されている。

ここで、膜厚の測定は、光度測定データ値を光 電測光器14により A / D 変換器15を介してコンピューク20に周期的に読み込んで行う。

そして、該拠定値がその前に拠定した値より増 減したか否かを判別し、該増減回数がある一定の ある場合、極小点と判定する。

(作用)

本発明によれば、上記したように、真空蒸者における股厚値の判定方法において、光電測光器の測定値軌跡について、読み取った測定値が前の値に比べ増減したかを判別し、その増減回数がある一定の値に達した場合、極大(極小)点と判定する。従って、真空蒸着の状態を正確に監視することができる。

従って、真空蒸着の状態を正確に検出して、適 切な真空蒸着の制御を行うことができる。

(実施例)

以下、本発明の実施例について図面を参照しながら詳細に説明する。

第1図は本発明の実施例を示す蒸粕膜の極点の 判定を行うためのシステム構成図、第2図は本発 明の極大点の判定フローチャート、第3図は本発 明の極小点の判定フローチャート、第4乃至第6 図は本発明の極小点の判定例の説明図である。

まず、第1図において、1はベルジャ、2は基

値に達した場合には極点と判定し、出力インタフェース26、蒸発源駆動装置27を介して蒸発源4を回転駆動させて、今まで行っていた試料を切換えて他の蒸発源の蒸発を行うなどの制御を行う。 以下、第2図のフローチャートを参照しながら、 算空蒸発における膜厚値(光電測光器の光度測定

まず、カウンタ25を Oにセットする (ステップ
の).

値)の極大点の判定について説明する。

次に、光電測光器14からの光度測定データ値の 読み込みを行う。つまり、"新版厚値"として周 期的に膜厚値を読み込み、その値A...を格納する (ステップの)。

次に、その時の読込値A:1をメモリ23へ記憶する(ステップ®)。

次いで、光電測光器14からの光度測定データ値 A.zの読み込みを行う (ステップ®)。

その時の測定データ値 A 」。が「新胶厚値」となり、測定データ値 A 」、は『旧膜厚値』となる (ステップ③)。

次いで、その測定データ値A...と前回の測定データ値A...とを比較器24により比較し(ステップ®)、その測定データ値A...が前回の測定データ値A...以下である場合には、カウンタ25の値をプラス1にする(ステップ®)。

次に、そのカウンタ25の値を判別して、その値 が所定値(ここでは 5)になった場合には、極大 点として判定する(ステップ®)。

上記ステップ®において、測定データ値 A 1.が 前回の測定データ値 A 1.より大きい場合には、カウンタ25の値をマイナス1にし(ステップ®)、そのカウンタ25の値を判別して、その値が一定値(ここでは 0)になる(ステップ®)まで、前記ステップ®に戻る。

また、上記ステップ®において、カウンタ25の値が0未満になる場合はその値を0に保持し(ステップ®)、前記ステップ®に戻る。

次に、第3図のフローチャートを参照しながら、 真空落着における膜厚値(光電測光器の光度測定 値)の極小点の判定について説明する。

前回の測定データ値 A x i より小さい場合には、カウンタ 25の値をマイナス 1 にし(ステップ®)、そのカウンタ 25の値を判別して、その値が所定値(ここでは 0) になる(ステップ®)まで、前記ステップ®に戻る。

また、上記ステップ®において、カウンク25の 値が 0 未満になる場合にはその値を 0 に保持して (ステップ®)、前記ステップ®に戻る。

次に、この真空蒸着における限厚値(光電測光器の光度測定値)の極小点の判定例について、第4図乃至第6図を用いて説明する。

第4図に光度測定値の軌跡が示されており、その極小点判定の詳細を示する部が拡大図として第5図に示されている。そこで、第5図において、測定ポイント4までは測定データ値が減少しているので、カウンタ値は0に保持され、測定ポイント5において測定データ値は大きくなり、カウンタ値は1となり、測定ポイント6では測定データ値が減少してカウンタ値は0となり、測定ポ

まず、カウンタ25を 0 にセットする (ステップ 60)

次に、光電測光器14からの光度測定データ値の 読み込みを行う (ステップの)。

次に、その時の読込値A*1をメモリ23へ記憶する(ステップΦ)。

次いで、光電測光器14からの光度測定データ値 A **の読み込みを行う(ステップ®)。

その時の測定データ値 A z z が * 新膜厚値 * となり、測定データ値 A z z は * 旧膜厚値 * となる(ステップな)。

次いで、その測定データ値Assと前回の測定データ値Assとを比較器24により比較し(ステップ
の)、その測定データ値Assが前回の測定データ
値Ass以上である場合には、カウンタ25の値をプ
ラス1にする(ステップの)。

次に、そのカウンタ25の値を判別して、その値が所定値(ここでは5)になった場合には、極小点として判定する(ステップ®)。

上記ステップ®において、測定データ値Assが

イント7では測定データ値が大きくなりカウンタ 値は1となり、測定ポイント8では測定データ値 が減少してカウンタ値は0となり、測定ポイント 9では測定データ値が大きくなりカウンタ値は1 となり、以降は測定データ値が増え続け、測定ポ イント13になるとカウンタ値は所定の5となり、 測定データ値の上昇傾向が確認され、極小点として判定される。

このように、真空蒸着における膜厚値の極大点 或いは極小点を正確に判定し、検出することがで きるので、正確な真空蒸着の制御を行うことがで きる。

なお、このようにして、得られる真空蒸着膜は、 プラウン管、プリズムなどの蒸着膜として用いられる。

また、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

(発明の効果)

特開平2-163374 (4)

以上、詳細に説明したように、本発明によれば、 蒸着膜の光電測光器の測定値における極大点、極 小点を誤判定することなく、正確に判定すること ができる。特に、ノイズ成分を含む信号値につい ても確実に極点の判定を行うことができる。また、 本発明によれば、時間軸に対し、非線形に連続に 変化するあらゆる信号値軌跡の極点を判定すること ともできる。

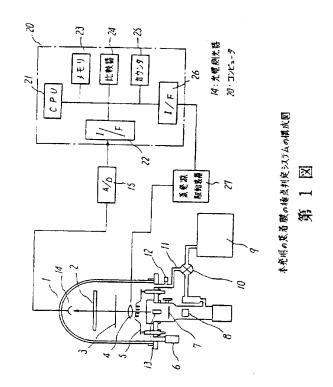
従って、真空蒸者における膜厚値の極大点或いは極小点を正確に判定し、検出することができるので、正確にして信頼性の高い真空蒸者の制御を 行うことができる。

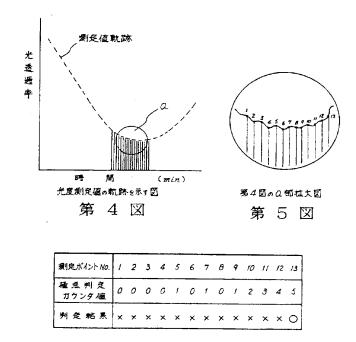
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例を示す療者膜の極点の 判定を行うためのシステムの構成図、第2図は本 発明の極大点の判定フローチャート、第3図は本 発明の極小点の判定フローチャート、第4図は本 発明の極小点の判定例における光度測定値の軌跡 を示す図、第5図は第4図のa部の拡大図、第6 図はその光度測定値の極小点判定の説明図、第7 図は従来の真空蒸着における蒸着膜の光電測光器 による光度測定軌跡を示す図である。

14…光電測光器、15… A / D 変換器、20…コンピュータ、21… C P U (中央処理装置)、22…入力インタフェース、23…メモリ、24…比較器、25…カウンタ、26…出力インタフェース。

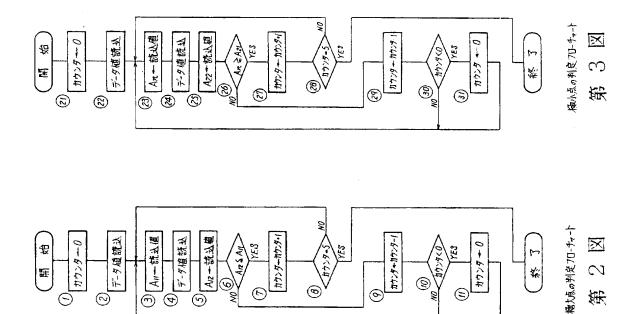
特許出願人 神電気工業株式会社代理人 弁理士 清水 守(外1名)

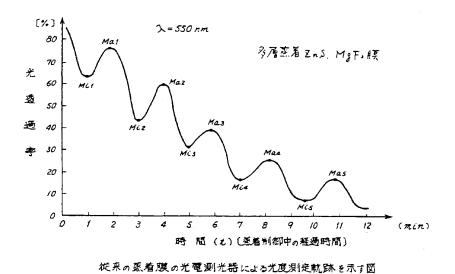




極小点判定の説明図第 6 図

策





第 7 図